

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2012년 11월 1일 (01.11.2012)



(10) 국제공개번호
WO 2012/148074 A1

- (51) 국제특허분류:
B22F 8/00 (2006.01) B22F 3/12 (2006.01)
B22F 9/14 (2006.01) B22F 9/04 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2012/000737
- (22) 국제출원일: 2012년 1월 31일 (31.01.2012)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2011-0038916 2011년 4월 26일 (26.04.2011) KR
- (71) 출원인 (US 을(를) 제외한 모든 지정국에 대하여): **희성 금속 주식회사 (HEE SUNG METAL LTD.)** [KR/KR]; 인천광역시 서구 가재울로 14 (가좌동), 404-817 Incheon Metropolitan City (KR).
- (72) 발명자; 겸
- (75) 발명자/출원인 (US 에 한하여): **윤원규 (YOON, Won Kyu)** [KR/KR]; 인천광역시 남동구 남동대로 117(고잔동) 희성금속 주식회사내, 405-820 Incheon Metropolitan City (KR). **양승호 (YANG, Seung Ho)** [KR/KR]; 인천광역시 남동구 남동대로 117(고잔동) 희성금속 주식회사내, 405-820 Incheon Metropolitan City (KR). **홍길수 (HONG, Gil Su)** [KR/KR]; 인천광역시 남동구 남동대

로 117(고잔동) 희성금속 주식회사내, 405-820 Incheon Metropolitan City (KR).

(74) 대리인: **신관호 (SHINN, Kwan Ho)**; 서울특별시 서초구 서운로 19, 1209 호 (서초동, 서초월드오피스텔), 137-862 Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

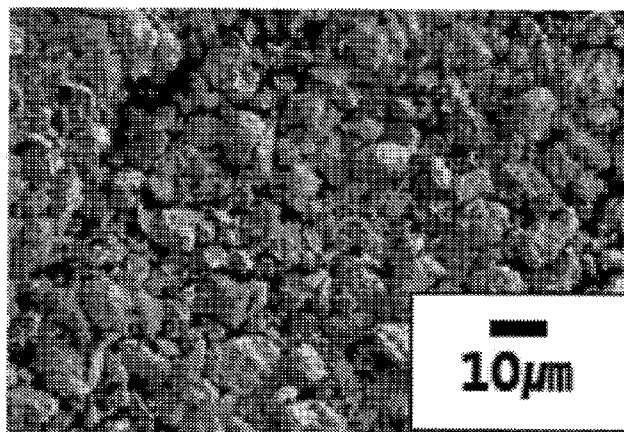
(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[다음 쪽 계속]

(54) Title: PRODUCTION METHOD FOR ULTRA-HIGH-PURITY RUTHENIUM (RU) POWDER AND TARGET BY USING WASTE RUTHENIUM (RU) TARGETS

(54) 발명의 명칭 : 폐 루테늄(Ru) 타겟을 이용한 초고순도 루테늄(Ru) 분말 및 타겟의 제조방법

[Fig. 3]



(57) Abstract: The present invention relates to a production method for an ultra-high-purity ruthenium powder and target by using waste ruthenium (Ru) targets; being devised in order to overcome disadvantages such as the long time and high costs entailed in dissolving waste targets and producing powder using chemical agents during production through the use of an existing wet method, and environmental pollution problems like waste-water treatment following the use of many types of chemical agents. In order to bring about an improvement, a high-density ruthenium (Ru) target is obtained by straightforwardly eliminating extraneous material and the like on the surface of a waste ruthenium (Ru) target by means of a chemical or mechanical method on the surface, and by using plasma-based ruthenium (Ru) powder production and heat treatment and crushing in fine high-purity ruthenium (Ru) powder production and sintering.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]